

# Semiconductor Photolithography Production Tool

## 自動塗布 / 現像装置 LITHOTRAC Dual-1000

2 インチ～ 300mm ウェーハに対応したレジスト塗布 / 現像装置です。生産ラインから開発まで、用途に応じた仕様でご提供しています。



## セミオート塗布装置 Litho Spin Cup 800C/1200C

多彩な機能と豊富なオプションにより、高度なスピン塗布が行えます。フォトレジストやポリイミド等の塗布材料に対して、最適な条件出しが可能です。450mm ウェーハに対応できるモデルもご用意しています。



## 自動塗布ベーク装置 LITHOTRAC CB-50

化学増幅型レジスト、高粘度塗布材料、2 インチ以下の小型基板等、レジスト塗布プロセスに合わせたモデルを用意しています。



## セミオート現像装置 Litho Spin Cup 800D/1200D

柔軟な設計思想により、各種現像方式に対応した装置をご提供します。セミオートながら自動機並みの安定した処理能力を持ち、少量生産ラインでも採用いただいています。



## 自動現像ベーク装置 LITHOTRAC DB-50

アルカリ現像仕様と有機現像仕様を選択できます。また、パドル現像やスプレー現像等各種現像方式に対応しています。



## minimal コータデベロッパ coater/developer

リソテックジャパンは、国立研究開発法人産業技術総合研究所ファブシステム研究会及び一般社団法人ミニマルファブ推進機構に参画し、ミニマルコータ、ミニマルデベロッパの開発・製造を行っています。



## マニュアルベーク装置 LWB-03 series

様々なウェーハ形状に対応した卓上型のベークプレートから、冷却機能付きの高精度ベークまで各種取り揃えています。



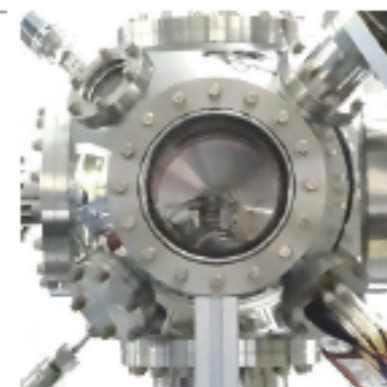
## 膜厚測定装置 KV-300/KF-10/L-2

レジストやポリイミド等、500µm までの厚膜を測定。全自動測定から低価格のマニュアル測定まで各種ラインナップしています。また、極薄ウェーハ等の厚さを測定できる Si-71 もラインナップしています。



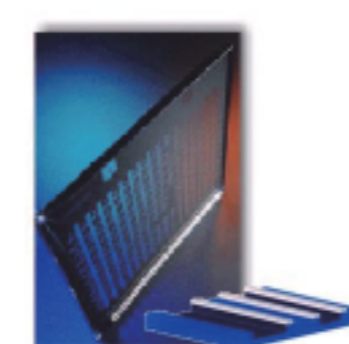
## レジストアウトガス評価ツール ROA-EI

シリコンウェーハに塗布されたレジストを露光しながら Dose 量毎のアウトガス量をモニタリングでき、直接評価を行えます。



## 露光装置検査用レチクル PSFM Reticle

露光量に依存せず、定量的なフォーカスデータを提供します。また、レンズに対する熱の影響を迅速に、かつ定量的に評価します。



## レジスト解析用露光装置 UVES-2000

実験用オープンフレーム露光装置です。Hg-Xe ランプを搭載し、フィルタにより 248nm、365nm、405nm、436nm およびブロード光での露光が可能です。



## レジスト現像アナライザ RDA-790

レジスト現像アナライザは、最新鋭の 18 チャンネル現像速度解析評価装置です。フォトレジストの現像速度測定、コントラストカーブ、感度の算出などの現像特性解析が迅速に行えます。



## レジスト解析用露光装置 VUVES-4700

実験用オープンフレーム露光装置です。LD レーザー励起白色光源を搭載し、248nm、193nm でも露光が可能です。



## レジスト現像アナライザ RDA-800

フォトレジストの現像速度評価が可能です。γ値、コントラストカーブ、表面難溶化パラメータ、現像パラメータの算出が可能です。ArF レジストの様な高 Rmax レジストにも対応しています。



## レジスト解析用 EUV 露光装置 EUVES-7000

実験用オープンフレーム露光装置です。ディスチャージ型 EUV 光源 (Energetiq 社製) を搭載し、13.5nm での露光に対応します。



## レジスト現像アナライザ RDA-Qz3

QCM (クォーツ・クリスタル・マイクロバランス) 法を用い、現像するレジスト膜の質量変化を利用した現像アナライザです。現像中の膨潤挙動の観察も可能です。



## UV ナノインプリント装置 LTNIP-500

実験用簡易 UV ナノインプリント装置です。プレス圧力最大 350N まで対応し、プレスしながら UV 照射を行います。



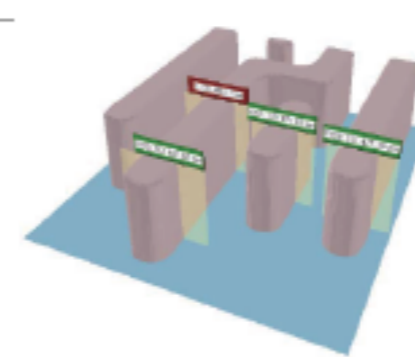
## EUV 光源 EQ-10HP

Energetiq 社製ディスチャージ型 EUV 光源です。波長 13.5nm の EUV 光 (極端紫外線) を応用した EUV レジストの評価、顕微鏡、欠陥検査等に最適です。



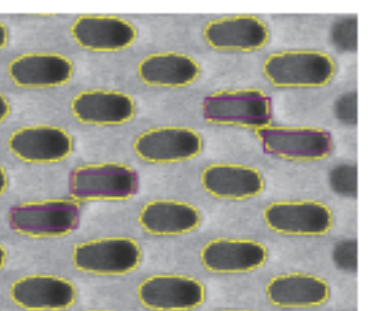
## Lithography Simulator PROLITH

パターンがウェーハ上にどのように転写されるかを、素早くかつ正確にシミュレートするための高度なモデルを搭載しています。



## ラフネス解析ツール MetroLER

Fractilia 社独自の技術 FILM により、さまざまな測定条件下の SEM 画像から、正確にパターンのエッジを検出し、ラフネス解析を行います。



リソテックジャパンならではの半導体フォトリソグラフィの知識と経験を活かし、お客様にとって最適な仕様をご提案し、さまざまなリソグラフィ評価ツールや製造装置をご提供しています。

半導体デバイス製造の他、リソグラフィ薬液材料、基板、フォトマスク、半導体製造装置の分野にて多くのお客様に採用いただいています。各製品毎にご評価のためのデモンストレーションやレジスト評価等の受託測定や受託研究を行っています。お気軽にお問い合わせください。